



STATE OF NEW YORK | EXECUTIVE CHAMBER

ANDREW M. CUOMO | GOVERNOR

Para publicación inmediata: 2 de abril del 2014

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO HITO PARA EL CONSORCIO GLOBAL 450MM

Primera herramienta de litografía por inmersión de 450mm de Nikon en el mundo entra en línea; producción de obleas programada para iniciar en junio

El Gobernador Andrew M. Cuomo, junto con Nikon Corporation, Tokyo Electron, y el Colegio de Ciencia e Ingeniería a Nanoescala (por sus siglas en inglés, "CNSE") de SUNY anunció hoy que la primera herramienta de fotolitografía por inmersión de 450mm del mundo empezará a estampar y entregar obleas en junio del 2014 en apoyo al Consorcio Global 450mm (por sus siglas en inglés, "G450C"). El G450C, con sede en el CNSE en Albany, New York, es una sociedad público-privada anunciada por el Gobernador Cuomo en septiembre del 2011 que está diseñada en parte para facilitar la transición de la industria de nanotecnología a tecnología de chips de computadora de próxima generación.

Este hito crítico permitirá a los miembros fundadores del G450C y al CNSE realizar fotolitografía de 10 nanómetros (1 nanómetro es una mil-millonésima parte de un metro) y más pequeña en obleas completas de silicio, a la vez que optimiza la configuración y desempeño de la herramienta. Al completar la optimización, la herramienta de Nikon Corporation será entregada al CNSE en abril del 2015 de acuerdo con el cronograma del proyecto.

"New York se está convirtiendo en líder mundial en nanotecnología, lo que está creando empleos y haciendo crecer nuestra economía en el norte de New York," dijo el Gobernador Cuomo. "Estas sociedades público-privadas están impulsando innovaciones que un día cambiarán la manera en que vivimos. Es una manera más en que New York es un pionero en los empleos e industrias del futuro, incluyendo la industria de semiconductores que ya es responsable de miles de empleos en el estado."

En julio, el Gobernador Cuomo anunció una sociedad de \$350 millones entre Nikon Corporation y CNSE para desarrollar tecnología de fotolitografía de 450mm de próxima generación y crear 100 empleos en alta tecnología. La fotolitografía es la técnica altamente sofisticada de usar luz intensa para imprimir complejos circuitos en el proceso de fabricación de chips de computadora. Durante los últimos años, la fotolitografía se ha convertido en el principal paso para la manufactura de transistores medidos en nanómetros, que son los bloques de construcción de los chips de computadora de hoy. Nikon

Spanish

Corporation, Tokyo Electron y CNSE han trabajado agresivamente para poner en funcionamiento la primera herramienta de su clase en menos de 12 meses y avanzar así la transición de la industria de la plataforma actual para obleas de 300 mm a la siguiente generación de plataforma de obleas de 450mm.

El vicepresidente ejecutivo de Nikon Corporation y presidente de Precision Equipment Company Kazuo Ushida dijo, “La transición de la industria a 450mm permite más innovaciones que darán un costo reducido por placa, lo que es esencial para la continuación de la Ley de Moore. Nikon está orgullosa de alcanzar esta fase clave. El desarrollo de escáneres de 450mm está progresando de acuerdo a lo planeado para garantizar que las herramientas de fotolitografía avanzada lleguen a satisfacer los requerimientos de los fabricantes de chips, y estarán listas para inserción cuando la industria decida hacer esta transición crítica.”

El vicepresidente de innovación de manufactura de CNSE y gerente general de G450C Paul Farrar Jr. dijo, “El anuncio de hoy reafirma en compromiso de la industria de hacer la transición a tecnología de obleas de 450 mm. Hasta la fecha, hemos instalado más de \$350 millones en herramientas para obleas de 450mm. Con la llegada de la herramienta de fotolitografía por inmersión de Nikon, esa inversión aumentará hasta \$700 millones. Nuestros proveedores de equipo siguen plenamente comprometidos con G450C, y nuestras empresas miembro siguen comprometiendo su completo apoyo por medio de inversiones y asignaciones técnicas.”

La herramienta de inmersión de Nikon se unirá a la infraestructura de 450mm existente en el CNSE en abril del 2015. Las evaluaciones de desempeño muestran que las herramientas actualmente en sitio en CNSE están superando las expectativas en capacidad, uniformidad de procesos y niveles de defectos. Además, se han establecido dos fuentes para proveer obleas de 450mm al G450C.

“El Gobernador Cuomo ha establecido al Estado de New York como el líder en la transición a tecnología de obleas de 450mm”, agregó Farrar. “Esta iniciativa no es sólo una iniciativa de New York; es una iniciativa mundial que impactará el desarrollo de dispositivos de alta tecnología para generaciones futuras. Conforme nos preparamos a ser testigos de la entrada en funcionamiento de la primera herramienta de inmersión de 450mm, apenas empezamos a darnos cuenta de los impactos de la valerosa visión del Gobernador Cuomo”.

Acerca de SUNY CNSE. El Colegio de Ciencia e Ingeniería a Nanoescala (por sus siglas en inglés, “CNSE”) de SUNY es líder mundial en las disciplinas emergentes de nanociencias, nanoingeniería, nanobiociencias y nanoeconomía. CNSE representa la empresa de investigación más avanzada del mundo impulsada por una universidad, con más de \$20 mil millones en inversiones de alta tecnología y más de 300 socios corporativos. El megaplex NanoTech de Albany, con 1.3 millones de pies cuadrados, es hogar de más de 3,100 científicos, investigadores, ingenieros, estudiantes y profesores. CNSE mantiene una presencia a nivel estatal, operando el Centro de Innovación de Tecnología para Ciudades Inteligentes (por sus siglas en inglés, “SCiTI”) en Kiernan Plaza, en Albany, el Centro de Desarrollo de Energía Solar en Halfmoon, la Instalación de Desarrollo de Manufactura y Tecnología Fotovoltaica en Rochester, y el Centro de Tecnología y Comercialización de Sistemas Inteligentes (por sus siglas en

inglés, “STC”) en Canandaigua. CNSE fue co-fundador y administra el Centro de Comercialización de Chips de Computadora (Quad-C) en SUNYIT, y es desarrollador líder del sitio Marcy Nanocenter en Utica, así como del Centro de Energía Verde de Riverbend, el Centro de Innovación de Manufactura de Alta Tecnología y el Centro de Innovación y Comercialización Médica, todos en Buffalo. Para obtener información, visite www.sunycnse.com.

###

Notas adicionales disponibles en www.governor.ny.gov
Estado de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418